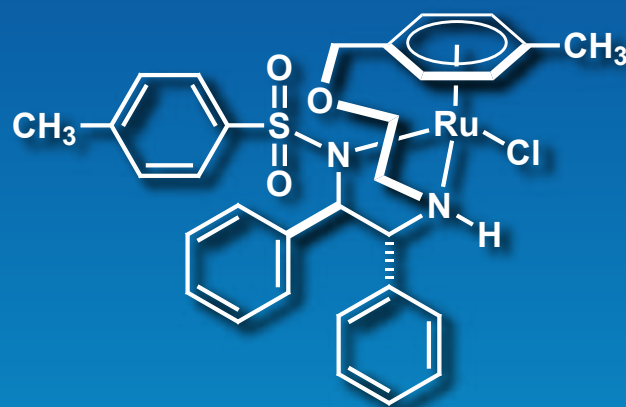


ケトン選択的 不斉水素移動反応ルテニウム触媒



(*S,S*)-Ts-DENEB®
200mg / 1g
[T3077]

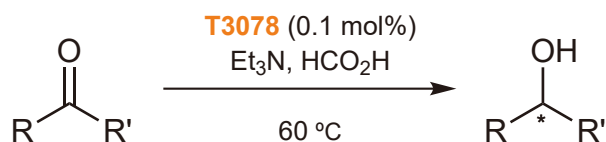


(*R,R*)-Ts-DENEB®
200mg / 1g
[T3078]

特長

- ・カルボニル化合物を選択的に還元
- ・ギ酸やIPAを水素源とするため高圧設備が不要

利用例

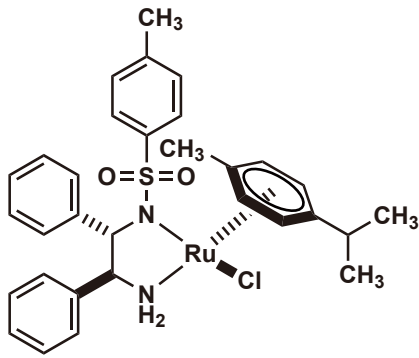


Substrate	Time (h)	% Yield	% ee
	3	>99	98 (<i>R</i>)
	5	>99	97 (<i>S</i>)
	5	98	96 (<i>S</i>)
	5	>99	>99 (<i>R</i>)
	5	>99	98 (<i>R</i>)

引用文献 T. Ikariya et al., *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, 133, 14960. <https://doi.org/10.1021/ja207283t>

高砂香料工業株式会社とのタイアップにより製品化しました。DENEB®は高砂香料工業株式会社の登録商標です。

他のルテニウム触媒

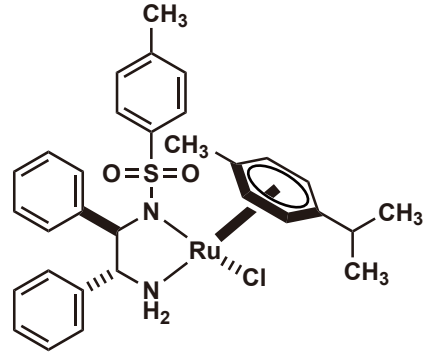


RuCl[(S,S)-Tsdpen](p-cymene)

200mg / 1g

[R0124]

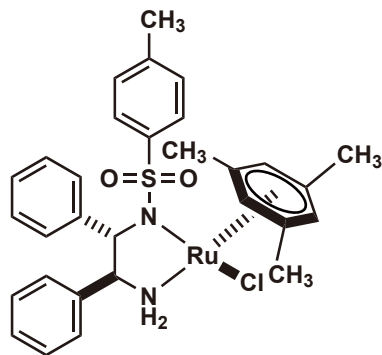
引用文献 R. Noyori et al., *J. Am. Chem. Soc.* **1996**, 118, 2521. <https://doi.org/10.1021/ja954126l>
K. Matsumura et al., *J. Am. Chem. Soc.* **1997**, 119, 8738. <https://doi.org/10.1021/ja971570a>
R. Noyori et al., *J. Am. Chem. Soc.* **1996**, 118, 4916. <https://doi.org/10.1021/ja960364k>



RuCl[(R,R)-Tsdpen](p-cymene)

200mg / 1g

[R0125]

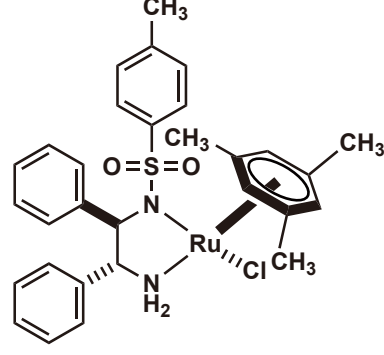


RuCl[(S,S)-Tsdpen](mesitylene)

200mg / 1g

[R0126]

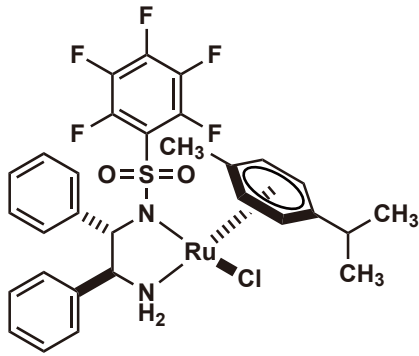
引用文献 R. Noyori et al., *J. Am. Chem. Soc.* **1996**, 118, 2521. <https://doi.org/10.1021/ja954126l>
R. Noyori et al., *Org. Lett.* **2000**, 2, 3425. <https://doi.org/10.1021/ol0002119>



RuCl[(R,R)-Tsdpen](mesitylene)

200mg / 1g

[R0127]



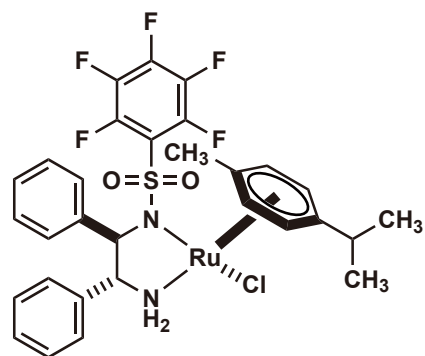
RuCl[(S,S)-Fsdpen](p-cymene)

200mg / 1g

[R0122]

引用文献 J. Limanto et al., *Org. Lett.* **2010**, 12, 512. <https://doi.org/10.1021/ol902715d>

高砂香料工業株式会社とのタイアップにより製品化しました。



RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene)

200mg / 1g

[R0123]

東京化成工業株式会社

試薬製品について

■本社営業部 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町 8 階
Tel: 03-3668-0489 Fax: 03-3668-0520 E-mail: Sales-JP@TCIchemicals.com

■大阪営業部 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 1-1-21 第 2 中井ビル 1 階
Tel: 06-6228-1155 Fax: 06-6228-1158 E-mail: osaka-s@TCIchemicals.com

スケールアップ、受託サービス(合成・開発・製造)について

□化成品営業部 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町 8 階
Tel: 03-5651-5171 Fax: 03-5640-8021 E-mail: finechemicals@TCIchemicals.com

弊社製品取扱店

本誌掲載の化学製品は試験・研究用のみ使用するものです。化学知識のある専門家以外の方のご使用はお避けください。目次や製品情報等、掲載内容の変更を予告なく行う場合があります。内容の一部または全部の無断転載・複製はご遠慮ください。